PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-057084

(43)Date of publication of application: 03.03.1995

(51)Int.CI.

G06T 7/00

(21)Application number: 05-217939

(71)Applicant:

YAMATAKE HONEYWELL CO LTD

(22)Date of filing:

11.08.1993

(72)Inventor:

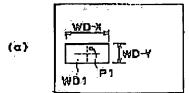
NAKAJIMA HIROSHI

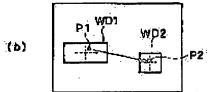
(54) FINGERPRINT COLLATING DEVICE

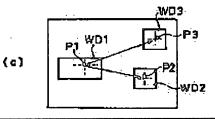
(57)Abstract:

PURPOSE: To increase collating speed by reducing a thinning processing when a collation is performed.

CONSTITUTION: When a collation is performed, at first, a feature point which is the highest criticality is defined as the first feature point, a first window WD 1 is opened by defining the coordinate location in the pattern of a collated fingerprint where the feature point may exist as a center. A first candidate point P1 is extracted by performing a thinning within the WD 1. Next, the coordinate location of the P1 is regarded as the coordinate location where the first feature point should be and a WD 2 is opened by defining the coordinated location where a second feature point may exist as a center. A second candidate point P2 is extracted by performing a thinning within the WD 2. Subsequently, by performing the same processing as the above, a WD 3 and the succeeding ones are opened after the coordinate location of the P1 is defined as the coordinate location where the first feature point should be, the thinning is performed within the area and a candidate point is extracted.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.05.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2865529

[Date of registration]

18.12.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

18.12.2001

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-57084

(43)公開日 平成7年(1995)3月3日

(51) Int.Cl.⁶

酸別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G06T 7/00

G06F 15/62

460

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 15 頁)

(21)出願番号

特顧平5-217939

(22)出顧日

平成5年(1993)8月11日

(71) 出頭人 000006666

山武ハネウエル株式会社

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

(72)発明者 中島 寛

神奈川県伊勢原市鈴川54番地 山武ハネウ

エル株式会社伊勢原工場内

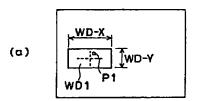
(74)代理人 弁理士 山川 政樹

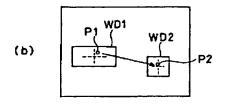
(54) 【発明の名称】 指紋照合装置

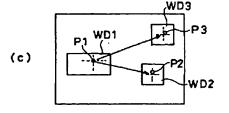
(57)【要約】

【目的】 照合の際の細線化処理を少なくして照合スピ ードを早める。

【構成】 照合時、先ず、重要度の一番高い特徴点を第 1番目の特徴点として、その特徴点があるであろう照合 指紋の紋様中の座標位置を中心とし、第1ウィンドウ♥ D1を開く。WD1内を細線化して第1候補点P1を抽 出する。次に、P1の座標位置を第1特徴点があるべき 座標位置とみなして、第2番目の特徴点があるであろう 座標位置を中心としてWD2を開く。WD2内を細線化 して第2候補点P2を抽出する。以下同様にして、P1 の座標位置を第1番目の特徴点のあるべき座標位置と確 定したうえ、WD3以降を開き、その領域内を細線化し て、候補点を抽出する。







【特許請求の範囲】

【請求項1】 登録指紋として採取された指紋の紋様中に適宜に原点を定め、この原点を中心として直交座標を定めたうえ、前記紋様中の複数の特徴点のデータを抽出し、この抽出した各特徴点のデータを登録データとして記憶しておき、照合指紋として採取された指紋より前記登録指紋と同様にしてその紋様中の複数の特徴点のデータを照合データとして抽出し、この抽出した照合データと前記登録データとに基づき前記照合指紋と前記登録指紋との照合を行う指紋照合装置において、

前記登録指紋の紋様中の各特徴点について重要度を決定 し、その決定した重要度に関する情報を含めて各特徴点 のデータを登録データとして記憶する登録データ記憶手 段と、

この登録データ記憶手段に記憶された重要度の高い順 に、その特徴点があるであろう前記照合指紋の紋様中の 座標位置を中心として探索領域を定め、その探索領域を 細線化して特徴点を抽出する特徴点抽出手段とを備えた ことを特徴とする指紋照合装置。

【請求項2】 請求項1において、登録データ記憶手段 20 に記憶された重要度の最も高い第1順位の特徴点があるであろう照合指紋の紋様中の座標位置を中心として第1の探索領域を定め、この第1の探索領域を細線化して第1の特徴点を抽出し、この抽出した第1の特徴点の座標位置を前記第1順位の特徴点があるべき座標位置とみなして、第2順位の特徴点があるであろう照合指紋の紋様中の座標位置を中心として第2の探索領域を定め、この第2の探索領域を細線化して第2の特徴点を抽出し、この抽出した第2の特徴点と前記第1の特徴点とを基準ペアとし、この基準ペアに基づき照合指紋の座標上での位 30 置補正を行う位置補正手段を備えたことを特徴とする指紋照合装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、指紋を用いて個人を認識する指紋照合装置に関し、特に指紋の紋様中の隆線あるいは谷線(本明細書では隆線と谷線とを総称して紋様線と呼ぶ)の端点および分岐点を特徴点として、これら特徴点の位置や方向、種類などに基づき、照合指紋と登録指紋との照合を行う指紋照合装置に関するものであ 40 る。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータ室や重要機械室への入退室管理、コンピュータ端末や銀行の金融端末へのアクセス管理などの個人認識を必要する分野において、これまでの暗証番号やIDカードに代わって、指紋照合装置が採用されつつある。この指紋照合装置は、操作部とコントロール部とからなり、操作部にはテンキーやディスプレイと共に指紋センサが設けられている。この指紋照合装置では、IDナンバーと対応づけて、利用者の指50

2

紋が登録されている。すなわち、運用する前に、利用者 が、テンキーを用いてIDナンバを入力のうえ、自己の 指紋を指紋センサに採取させると、この採取された指紋 (登録指紋)の紋様が256階調の濃淡画像(画像デー タ) としてコントロール部へ与えられる。コントロール 部は、この画像データより処理領域を抽出してその全体 を細線化し、その処理領域中に適宜に原点(例えば、処 理領域の中心点)を定め、この原点を中心として直交座 標(X-Y)を定めたうえ、処理領域中の全ての特徴点 (疑似特徴点を除く)のデータを抽出する。すなわち、 各特徴点について、その特徴点の位置、方向、種類(端 点、分岐点)を抽出する。そして、この抽出した各特徴 点のデータを登録データとしてメモリ中に記憶する。と れにより、運用中、利用者が、テンキーを用いてIDナ ンパを入力のうえ、自己の指紋を指紋センサに採取させ ると、この採取された指紋(照合指紋)の紋様が画像デ ータとしてコントロール部へ与えられ、上記登録指紋の 場合と同様にして処理領域が抽出されその全体が細線化 されたうえ、その処理領域中の全ての特徴点(疑似特徴 点を除く)のデータ(照合データ)が抽出され、この抽 出した照合データと記憶されている登録データとを比較 するとにより、照合指紋と登録指紋との照合が行われ る。なお、照合に際して、照合指紋のXY方向の最長隆 線幅分布波形を求め、これを登録指紋のXY方向の最長 隆線幅分布波形と比較し、照合指紋の座標上での位置補 正を行っている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の指紋照合装置によると、指紋照合を行う際、 処理領域の全体に対して細線化を行い特徴点を抽出する ものとしているため、細線化処理に時間を要し、照合時間が長引くという問題があった。また、照合指紋の座標 上での位置補正をXY方向の最長隆線幅分布に基づいて 行うものとしているものの、XY方向のみの補正であっ て、精度が高いとは言えなかった。

【0004】本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、照合の際の細線化処理を少なくして、照合スピードを早めることの可能な指紋照合装置を提供することにある。また、照合スピードを早めると共に、照合指紋の座標上での位置補正を髙精度で行い、照合精度を髙めることの可能な指紋照合装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】とのような目的を達成するために、その第1発明(請求項1に係る発明)は、登録指紋の紋様中の各特徴点について重要度を決定し、その決定した重要度に関する情報を含めて各特徴点のデータを登録データとして記憶する登録データ記憶手段と、この登録データ記憶手段に記憶された重要度の高い順に、その特徴点があるであろう照合指紋の紋様中の座標

位置を中心として探索領域を定め、その探索領域を細線化して特徴点を抽出する特徴点抽出手段とを備えたものである。また、その第2発明(請求項2に係る発明)は、第1発明において、登録データ記憶手段に記憶された重要度の最も高い第1順位の特徴点があるであろう照合指紋の紋様中の座標位置を中心として第1の特徴点を定め、この第1の探索領域を細線化して第1の特徴点を抽出し、この抽出した第1の特徴点があるべき座標位置とみなして、第2順位の特徴点があるであろう照合指紋の紋様中の座標位置を中心として第2の探索領域を定め、この第2の探索領域を細線化して第2の探索領域を定め、この第2の探索領域を細線化して第2の特徴点を抽出し、この抽出した第2の特徴点と第1の特徴点とを基準ペアとし、この基準ペアに基づき照合指紋の座標上での位置補正を行うようにしたものである。

[0006]

【作用】したがってこの発明によれば、その第1発明で は、照合時、登録データ記憶手段に記憶された重要度の 髙い順に、その特徴点があるであろう照合指紋の紋様中 の座標位置を中心として探索領域が定められ、その探索 20 領域のみが細線化されて特徴点が抽出される。また、そ の第2発明では、照合時、登録データ記憶手段に記憶さ れた重要度の最も高い第1順位の特徴点があるであろう 照合指紋の紋様中の座標位置を中心として第1の探索領 域が定められ、この第1の探索領域が細線化されて第1 の特徴点が抽出され、この抽出された第1の特徴点の座 標位置を第1順位の特徴点があるべき座標位置とみなし て、第2順位の特徴点があるであろう照合指紋の紋様中 の座標位置を中心として第2の探索領域が定められ、と の第2の探索領域が細線化されて第2の特徴点が抽出さ 30 れ、この抽出された第2の特徴点と第1の特徴点とが基 準ペアとされ、この基準ペアに基づいて照合指紋の座標 上での位置補正が行われる。

[0007]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づき詳細に説明する。図2はこの発明の一実施例を示す指紋照合装置のブロック構成図である。同図において、1は操作部、2はコントロール部であり、操作部1にはテンキー1-1、ディスプレイ(LCD)1-2と共に指紋センサ1-3が設けられている。指紋センサ1-3は光源1-31、プリズム1-32、CCDカメラ1-33を備えてなる。コントロール部2は、CPUを有してなる制御部2-1と、ROM2-2と、RAM2-3と、ハードディスク(HD)2-4と、フレームメモリ(FM)2-5と、外部接続部(1/F)2-6とを備えてなり、ROM2-2には登録プログラムと照合プログラムが格納されている。

【0008】 [指紋の登録] との指紋照合装置において (図7に示すステップ201)。そして、「1」レベル利用者の指紋は次のようにして登録される。すなわち、 の連続のうち、最も長い画素数を選択し、その長さしな 運用する前に、利用者は、テンキー1-1を用いて自己 50 をnに対応して記憶する(ステップ202)。そして、

4

に割り当てられた I Dナンバを入力のうえ、指紋センサ 1-3のブリズム1-32上に指を置く。ブリズム1-32には光源1-31から光が照射されており、プリズム1-32の面に接触しない指紋の凹部(谷線部)では、光源1-31からの光は全反射し、CCDカメラ1-33に至る。逆にプリズム1-32の面に接触する指紋の凸部(隆線部)では全反射条件がくずれ、光源1-31からの光は散乱する。これにより、指紋の谷線部は明るく、隆線部は暗い、コントラストのある指紋の紋様が採取される。との採取された指紋(登録指紋)の紋様は、A/D変換により、320×400画素、256階調の濃淡画像(画像データ)として、コントロール部2へ与えられる。

【0009】コントロール部2の制御部2-1は、テンキー1-1を介して1Dナンバが与えられると(図3に示すステップ101)、ROM2-2に格納されている登録プログラムに従い、CCDカメラ1-33からの画像データをフレームメモリ2-5を介して取り込み(ステップ102)、その画質をチェックする(ステップ103)。画質が悪ければ、ステップ102へ戻って画像データの再取り込みを行ない、画質が良ければ、取り込んだ画像データに対して処理領域の抽出を行う(ステップ104)。

【0010】ステップ104での処理領域の抽出は、16×16画素を1ブロック(局所領域)とし、1ブロック毎にその濃淡値の平均を出して所定レベルと比較することにより行う。すなわち、所定レベル以下のブロックを背景領域として除き、所定レベル以上のブロックを処理領域として抽出する。

【0011】そして、この抽出した処理領域に対し、ノイズ除去を行なう(ステップ105)。ここでのノイズ除去は、 3×3 画素毎に、その周りの画素の濃淡値の平均を求め、これをその中央の画素の濃淡値とすることにより行う。すなわち、図4に示す 3×3 画素において、e=(a+b+c+d+f+g+h+i)/8とすることにより、 3×3 画素毎にノイズ除去を行う。そして、ノイズ除去を行った処理領域に対し、1 ブロック(局所領域)毎に2 値化を行う(ステップ106:図5参照)。

0 【0012】次に、ステップ107へ進み、処理領域の 2値化画像に対し背景領域の各画素を全て「0」レベル とした320×400画素の画像データについて、その XY方向(X: 横軸方向、Y: 縦軸方向)の最長隆線幅 分布波形を求める。

【0013】すなわち、図6に示す320×400画素の画像データについて、y=n上をX軸方向にスキャンして「0」、「1」レベルの連続する画素数を求める(図7に示すステップ201)。そして、「1」レベルの連続のうち、最も長い画素数を選択し、その長さLxをnに対応して記憶する(ステップ202)。そして、

す。

nをインクリメントし(ステップ203)、ステップ2 04へ進み、とのステップ204にてn≧400となる まで、ステップ201~204を繰り返す。これによ り、図8(a)に示すようなX方向の最長隆線幅分布波 形が求められる。

【0014】次に、x=m上をY軸方向にスキャンして 「0」、「1」レベルの連続する画素数を求める(ステ ップ205)。そして、「1」レベルの連続のうち、最 も長い画素数を選択し、その長さLyをmに対応して記 憶する (ステップ206)。そして、mをインクリメン トし (ステップ207)、ステップ208へ進み、この ステップ208にてm≥320となるまで、ステップ2 05~208を繰り返す。これにより、図8(b)に示

すようなY方向の最長隆線幅分布波形が求められる。 【0015】次に、この求めたXY方向の最長隆線幅分 布波形より、所定の法則にしたがってその特徴的な山 (リム) だけを抽出し、この抽出したリムによって構成 されるXY方向の最長隆線幅分布波形を最長隆線幅極大 値抽出波形として求める (ステップ108)。この最長 隆線幅極大値抽出波形は次のようにして求める。すなわ ち、X(Y)方向の最長隆線幅分布波形の要部を図9に 示して説明するに、今、①が最長隆線幅部分波形の極小 値候補とする。この場合、次の極大値②において、┃② -O|を算出する。CCで、|O-O|>aであるので (a=5画素)、②を極大値の候補(まだ確定しない) とする。②を極大値候補としたので、①を極小値として 確定する。次の極小値図において | ② - ③ | を算出す る。ことで、 | ② - ③ | < a であるので、③を除去す る。次に、極大値④において④と②との大小関係を比較 し、②が②よりも大きいので②を除去し、④を極大値候 30 補とする。そして、次の極小値⑤において | ⑤ - ④ | を 算出し、 | 5 - 4 | > a であるので、 4 を極大値として 確定し、5を極小値候補とする。次の極大値6において | 6-6 | を算出する。 ととで、 | 6-6 | < a である ので、6を除去する。そして、次の極小値のと6とを比 較し、のがらよりも大きいのでのを除去し、らを引き続 き極小値候補としておく。このようにして求めたX方向 およびY方向の最長隆線幅極大値抽出波形(確定した極 小値,極大値のうち極大値のみを抽出した波形)を図1 0 (a) および (b) に示す。また、図20および図2 40 1 に、最長隆線幅極大値抽出波形を生成するためのフロ ーチャートを示す。図20は極小値の決定フローを示 し、図21は極大値の決定フローを示す。なお、図20 において、最長隆線幅分布波形は必ず極小値(0)から 始まるため、ステップ501では、極小値(0)が最初 の極小値Aの候補とされる。また、ステップ517の実 行に際しては、確定された極大値B(B1)を「1」と し、極大値として確定されなかった他の部分については 「0」とする。

【0016】次に、ステップ109へ進み、処理領域の 50 【0020】次に、抽出した各特徴点について、その重

2.値化画像に対し細線化を行う。ことでの細線化は、端 点、分岐点すなわち特徴点を確定するために行うもので あり、ヒルディッチ(Hilditch)の逐次型細線化処理に 従う。すなわち、実際の指紋データの隆線はある幅をも っているので、そのまま使うと特徴点を確定することが できない。そとで、隆線の幅を細くする細線化処理を行 って、特徴点を確定することができるようにする。図1 1に細線化した後の処理領域の2値化画像の一部を示

【0017】次に、この細線化された処理領域の2値化 画像より、特徴点を抽出する(ステップ110)。この 特徴点の抽出は、例えば図11に示した処理領域の2値 化画像で説明すると、(-n+1, -n+1)から(n -1, n-1)までの3×3画素中の連結数を計算する ととにより行う。すなわち、図12(a)に示す3×3 画素において、Eの座標を(-n+1,-n+1)と し、Eの座標が (n-1, n-1) となるまで、順次3 ×3画素を移動させて行き、Eの座標が「1」レベルで ある3×3画素についてのみその連結数を計算し、連結 数が1であれば端点(特徴点)と判断し、3であれば分 岐点 (特徴点) と判断する。なお、連結数が0でれば孤 立点、2であれば連続点、4であれば交差点と判断す

【0018】連結数は、Eを中心とする周囲の画素 (A, B, C, D, F, G, H, I) について、隣合う 画素同志のレベルを引き算し、その引き算して得た値を 加算して2で除することによって求める。例えば、図1 2 (b) に示した3×3画素では、GとHとのレベル差 が1となり、HとIとのレベル差が1となり、その絶対 値の加算結果が2となることから、連結数として1が得 られ、これにより端点と判断される。また、図12 (c) に示した3×3 画素では、隣合う画素同志のレベ ルを引き算して得られる値の加算結果が6となることか ら、連結数として3が得られ、これにより分岐点と判断 される。

【0019】次に、抽出した各特徴点について、その特 徴点の位置・方向情報を抽出する(ステップ111)。 との特徴点の位置・方向情報の抽出は次のようにして行 う。先ず、処理領域のX方向の上下限の中心線とY方向 の上下限の中心線との交点を処理領域の中心点とし、と の中心点を原点(0,0)として各特徴点の座標上の位 置を求める。そして、端点については、図13(a)に 示すように、その端点P, の隆線を10画素分追跡し て、その最後の相対座標を、端点P。の方向情報とす る。また、分岐点については、図13(b)に示すよう に、その分岐点P。から各隆線を10画素分追跡した点 を終端とし、この終端により三角形を作り、3辺の中で 最短の辺の対角にある方向の相対座標を、分岐点P。の 方向情報とする。

要度を決定する (ステップ112)。 この特徴点の重要 度の決定は次のようにして行う。

[ランク:周りに別の特徴点がない目安(安定性)]先 ず、図17に示すように、特徴点Pを中心として、20 ×20画素の周囲領域S4を定め、この周囲領域S4に 別の特徴点が存在しないかどうかを調べる。もし、この 周囲領域S4に別の特徴点が存在すれば、その特徴点P については疑似特徴点としてランク付けから除外する。 周囲領域S4に別の特徴点が存在しなければ、24×2 4 画素の周囲領域S3を定め、この周囲領域S3に別の 10 特徴点が存在しないかどうかを調べる。周囲領域S3に 別の特徴点が存在すれば、周囲領域Sの段階に応ずるバ ラメータ (第1のパラメータ:ランク)をレベル「4」 とする。周囲領域S3に別の特徴点が存在しなければ、 30×30画素の周囲領域S2を定め、この周囲領域S 2 に別の特徴点が存在しなければ、40×40画素の周 囲領域S1を定める。周囲領域S2に別の特徴点が存在 すれば、ランクをレベル「3」とし、周囲領域S1に別 の特徴点が存在すれば、ランクをレベル「2」とする。 周囲領域S1に別の特徴点が存在しなければ、ランクを 20 レベル「1」とする。図14(a)に周囲領域Sの大き さとランクとの関係を示す。なお、この周囲領域Sは四 角形に限ることはなく、円形等としてもよい。

「ディスタンス:中心点からの近さの目安(再現性)〕次に、特徴点Pについて、中心点(0,0)からの距離を求める。との中心点からの距離が0~9 画素中にあれば、中心点までの距離に応ずるパラメータ(第2のパラメータ:ディスタンス)をレベル「0」とする。10~19 画素中にあれば、ディスタンスをレベル「1」とする。図14(b)に中心点からの距離とディスタンスと 30の関係を示す。

〔重要度: (ランク+ディスタンス)〕ランクとディスタンスとを加算した値を特徴点Pの重要度として決定する。そして、重要度の高い順(レベルの小さい順)に、各特徴点にプライオリティを付ける。

【0021】次に、ステップ113へ進み、登録ファイル化を行う。との登録ファイル化では、ステップ107,108での位置補正情報抽出処理によって抽出したXY方向の最長隆線幅極大値抽出波形、およびステップ109~112での特徴点情報抽出処理で抽出した各特 40 徴点のデータ(登録データ)を、入力IDナンバと対応づけてハードディスク2~4に格納する。すなわち、XY方向の最長隆線幅極大値抽出波形と共に、各特徴点について、その特徴点の位置情報、方向情報、種類、プライオリティについて、入力IDナンバと対応づけて登録する。との際、ステップ112にて疑似特徴点としてランク付けから除外した特徴点については、データの登録は行わない。

【0022】データの登録に際し、最長隆線幅分布波形ではなく、その特徴的な山だけを抽出した最長隆線幅極 50

大値抽出波形を位置補正情報として記憶させることによ り、また疑似特徴点を除外することにより、ハードディ

り、また疑似特徴点を除外することにより、ハードディスク2-4でのメモリの消費を少なくすることができる。

【0023】 〔指紋の照合〕 この指紋照合装置において利用者の指紋の照合は次のようにして行われる。すなわち、運用中、利用者は、テンキー1-1を用いて自己に割り当てられた I Dナンバを入力のうえ、指紋センサ1-3のプリズム1-32上に指を置く。これにより、指紋の登録の場合と同様にして、採取された指紋(照合指紋)の紋様が、320×400 画素、256 階調の濃淡画像(画像データ)として、コントロール部2へ与えられる。

【0024】コントロール部2の制御部2-1は、テンキー1-1を介して1Dナンバが与えられると(図15に示すステップ301)、ROM2-2に格納されている照合プログラムに従い、CCDカメラ1-33からの画像データをフレームメモリ2-5を介して取り込み(ステップ302)、その画質をチェックする(ステップ303)。画質が悪ければ、ステップ302に戻って画像データの再取り込みを行ない、画質が良ければ、取り込んだ画像データに対して処理領域の抽出を行う(ステップ304)。そして、この抽出した処理領域に対し、ノイズ除去を行ったうえ(ステップ305)、1ブロック(局所領域)毎に2値化を行う(ステップ306)。ステップ304~306での前処理は図3に示したステップ104~106での前処理と同じであるのでその説明は省略する。

【0025】次に、ステップ307へ進み、処理領域の2値化画像に対し背景領域の各画素を全て「0」レベルとした320×400画素の画像データについて、図3に示したステップ107と同様にして、そのXY方向の最長隆線幅分布波形を求める。そして、この求めたXY方向の最長隆線幅分布波形と入力IDナンバに対応して登録されているXY方向の最長隆線幅極大値抽出波形とに基づき、処理領域における2値画像で表された照合指紋の座標上での大まかな位置補正を行う(ステップ308)。

【0026】この大まかな位置補正に際しては、X (Y)方向の最長隆線幅分布波形とX (Y)方向の最長隆線幅極大値抽出波形とを比較し、X (Y)方向の最長隆線幅極大値抽出波形を構成する各リムについて、そのリムに対応する位置のX (Y)方向の最長隆線幅分布波形における前後±2画素の波形値との差をとる。そして、その差が最小のものを各リムに対するずれ量として求め、このずれ量を加算してリムの数で除し、リム1本当たりの平均的なずれ量を求める。そして、このずれ量をX (Y)方向の位置ずれ量とし、このX (Y)方向の位置ずれ量を最も小さくするように、処理領域における照合指紋の座標位置を補正する。

【0027】なお、上述した大まかな位置補正に際し、
最長隆線幅極大値抽出波形の各リムに対応する位置の最
長隆線幅分布波形における前後±2画素の波形値との差
をとり、その差が最小のものを各リムに対するずれ量と
して求めることにより、圧力のかけ方によって細くなっ
たり太くなったりする照合指紋の紋様について、そのひ
ずみを吸収することができる。また、X(Y)方向の最
長隆線幅分布波形とX(Y)方向の最長隆線幅極大値抽
出波形とを比較してX(Y)方向の位置ずれ量を求める
ようにすることにより、X(Y)方向の位置ずれ量を求める
ようにすることにより、X(Y)方向の位置ずれ量を求める
場合に比べて、その処理スピードが早くなる。

[0028] ステップ308で大まかな位置補正を行った後は、ステップ309へ進み、照合判定処理を行う。 この照合判定処理では、入力1Dナンバに対応して登録されている各特徴点の登録データをサーチし(図16に示すステップ401)、プライオリティの一番高い特徴点を第1番目の特徴点として、おおまかな位置補正の行われた上記照合指紋に対し、第1番目の特徴点があるであろうその紋様中の座標位置(登録座標位置)を中心として、第1ウィンドウ(探索領域)を開く(ステップ402:図1(a)参照)。この第1ウィンドウWD1の大きさWD-X、WD-Yは、ステップ308での大まかな位置補正に際して求めたX方向、Y方向の位置ずれ量(大まかな位置補正の計算値)から決定する。

【0029】図18(a)にX方向の大まかな位置補正の計算値Av-m1とWD-Xとの関係を示し、図18(b)にY方向の大まかな位置補正の計算値Av-m2とWD-Yとの関係を示す。すなわち、本実施例においては、大まかな位置補正が大きく行われた場合、第1ウィンドウWD1が大きく開かれ、小さく行われた場合、第1ウィンドウWD1が小さく開かれる。

【0030】そして、との開いた第1ウィンドウWD1の2値化画像に対し細線化を行い、特徴点を抽出する。そして、その抽出した特徴点について、位置情報および方向情報を抽出し、第1番目の特徴点に対応する第1候補点としてリストアップする(ステップ403)。との場合、第1候補点は、複数の場合もあり得る。図1

(a)では第1候補点が一つである場合を示している。 第1候補点がなければ、ステップ404での「NO」に 40 応じて直ちにステップ416へ進み、照合指紋と登録指 紋とが一致しない旨の表示を行う。第1候補点があれ ば、ステップ401へ戻り、次にプライオリティの高い 特徴点(第2番目の特徴点)について、第1候補点の座 標位置を第1番目の特徴点があるべき座標位置(登録座 標位置)とみなして、第2番目の特徴点があるであろう 照合指紋の紋様中の座標位置を中心とし、第2ウィンド ウを開く(ステップ405:図1(b)参照)。すなわ ち、第1候補点P1の座標位置を第1番目の特徴点のあ るべき座標位置とみなして、この第1候補点P1の座標 50

位置を起点として第2ウィンドウWD2を開く。この第 2ウィンドウWD2の大きさは一定である。

10

【0031】そして、この開いた第2ウィンドウWD2 の2値化画像に対して細線化を行い、特徴点を抽出す る。そして、その抽出した特徴点について、位置情報お よび方向情報を抽出する。この場合、第2候補点は、複 数の場合もあり得る。図l(b)では第2候補点が一つ である場合を示している。第2候補点P2が見つかれ は、その候補点P2について照合スコアを算出する。 C の照合スコアは、第2番目の特徴点に対する第2候補点 P2の位置,方向,種類の各誤差値(例えば、端点であ るべき特徴点が分岐点であればその誤差値を10とす る) を加算して求める。そして、第1候補点P1と第2 候補点P2とを基準点ペアとし、第1候補点が複数ある 場合には後述する如く基準点ペアを選定のうえ(ステッ プ406)、ステップ407および408での「YE S」に応じてステップ409へ進み、第1候補点P1の 座標位置を第1番目の特徴点のあるべき座標位置として 確定する(ステップ409)。これにより、ステップ3 08での大まかな位置補正に対し、高精度の再位置補正 が行われる。

【0032】なお、第2ウィンドウWD2において第2 候補点が見つからない場合には、ステップ408での 「NO」に応じてステップ416へ直ちに進み、照合指 紋と登録指紋とが一致しない旨の表示を行う。また、第 1ウィンドウWD1に第1候補点が複数ある場合には、 ステップ407での「NO」に応じてステップ405へ 戻り、次の第1候補点の座標位置を第1番目の特徴点が あるべき座標位置とみなして第2ウィンドウを開き、そ の開いた第2ウィンドウの2値化画像に対し細線化を行 って特徴点を抽出し、その抽出した特徴点を第2候補点 としてその照合スコアを算出する。以下同様にして、ス テップ407でのカウンタが第1候補点の数になるま で、上述の処理を繰り返し、第1候補点のすべてについ て、ペアとなる第2候補点およびその照合スコアを求め る。そして、との照合スコアを求めながら、その照合ス コアの最も低いペアを基準点ペアとして選定するものと し(ステップ406)、ステップ407でのカウンタが 第1候補点の数に達すれば、ステップ408を経てステ ップ409へ進み、基準点ペアの第1候補点を第1番目 の特徴点として確定し、その座標位置を第1の特徴点の あるべき座標位置として確定する。

【0033】とのようにして再位置補正を行った後、ステップ401へ戻り、次にプライオリティの高い特徴点(第3番目の特徴点)について、その特徴点があるであろう座標位置を中心とし、第3ウィンドウWD3を開く(ステップ410:図1(c)参照)。そして、この開いた第3ウィンドウWD3の2値化画像に対し細線化を行い、特徴点を抽出し、その抽出した特徴点(第3候補点)P3について位置情報および方向情報を抽出する。

できる。

そして、第3候補点P3の照合スコアを算出する(ステ ップ411)。以下同様にして、ウィンドウを開いても 特徴点(候補点)が抽出されなかった場合にはウィンド ウを追加して開くものとしたうえ、ステップ412にて 特徴点 (候補点) が13個となるまで上述の処理を繰り 返す。図19に照合指紋の紋様中に開かれたウィンドウ **WD1~WD13を例示する。**

【0034】なお、開いたウィンドウに特徴点が複数あ る場合には、一番スコアの少ない特徴点を候補点として 選ぶ。第13候補点の照合スコアの算出を終了すれば、 ステップ412での「YES」に応じてステップ413 へ進み、第1~第13候補点の照合スコアを合計する。 . そして、ステップ414へ進み、照合スコアの合計を予 め定められた所定値と比較し、所定値以下であれば、照 合指紋と登録指紋とが一致したと判定し、その旨の表示 を行うと共に(ステップ415)、I/F2-6を介し て電気錠用(自動ドア用)の出力を出す。所定値以上で あれば、照合指紋と登録指紋とが一致しないと判定し、 その旨の表示を行う (ステップ416)。

【0035】以上説明したように、本実施例によると、 照合時、重要度の高い順に、その特徴点があるであろう 照合指紋の紋様中の座標位置を中心としてウィンドウ♥ Dが開かれ、そのウィンドウWDのみが細線化されて特 徴点が抽出されるものとなり、照合の際の細線化処理が 少なくなって、照合スピードが早まるものとなる。ま た、本実施例によると、照合時、重要度の最も高い第1 順位の特徴点があるであろう照合指紋の紋様中の座標位 置を中心としてウィンドウWD1が開かれ、このウィン ドウWD1が細線化されて特徴点P1が抽出され、との 抽出された特徴点P1の座標位置を第1順位の特徴点が 30 あるべき座標位置とみなして、第2順位の特徴点がある であろう照合指紋の紋様中の座標位置を中心としてウィ ンドウWD2が開かれ、このウィンドウWD2が細線化 されて特徴点P2が抽出され、この抽出された特徴点P 2と特徴点P1とが基準ペアとされ、この基準ペアに基 づいて照合指紋の座標上での再位置補正が行われるもの となり、照合精度が高まるものとなる。

【0036】また、本実施例によれば、登録指紋の紋様 中の重要度の高い特徴点から順次、照合指紋の紋様中の 対応する特徴点の照合データが抽出され、その照合指紋 40 の紋様中の抽出特徴点が所定数に達すると照合が完了す るので、従来に比して照合スピードが格段に早まるもの となる。また、本実施例によれば、ランクとディスタン スとを加算した値として重要度を決定しているため、照 合の際の安定性と再現性とに優れ、登録時の指紋と照合 時の指紋の領域が大きくずれているような場合であって も、少ない特徴点の比較で、精度良く照合を行うことが できるものとなる。すなわち、本実施例によれば、全て の特徴点について照合を行う従来の指紋照合装置に対 し、照合精度を落とさず、照合スピードを早めることが 50 ク構成図である。

【0037】なお、本実施例においては、疑似特徴点と してランク付けから除外した特徴点を除く全ての特徴点 についてそのデータの登録を行うものとしたが、重要度 の高い所定順位まで(例えば、50番目まで)の特徴点 についてのみそのデータの登録を行うようにしてもよ い。とのようにすることにより、ハードディスク2-4 でのメモリの消費を少なくすることができる。

12

【0038】また、本実施例においては、ウィンドウを 開いても特徴点が抽出されなかった場合、ウィンドウを 追加して開くものとして、必ず13個の特徴点(候補 点) の照合スコアを算出するものとしたが、特徴点が抽 出されなかった場合には照合スコアを多くするものとし て、ウィンドウを追加して開かないようにしてもよい。 との場合、プライオリティの高い第1~第13番目まで の特徴点についてのみ、そのデータを登録しておくもの とすればよく、ハードディスク2-4でのメモリの消費 をさらに少なくすることが可能であり、処理スピードも 早くなる。

[0039]

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように本 発明によれば、その第1発明では、照合時、登録データ 記憶手段に記憶された重要度の高い順に、その特徴点が あるであろう照合指紋の紋様中の座標位置を中心として 探索領域が定められ、その探索領域のみが細線化されて 特徴点が抽出されるものとなり、照合の際の細線化処理 が少なくなって、照合スピードが早まるものとなる。ま た、その第2発明では、照合時、登録データ記憶手段に 記憶された重要度の最も高い第1順位の特徴点があるで あろう照合指紋の紋様中の座標位置を中心として第1の 探索領域が定められ、との第1の探索領域が細線化され て第1の特徴点が抽出され、との抽出された第1の特徴 点の座標位置を第1順位の特徴点があるべき座標位置と みなして、第2順位の特徴点があるであろう照合指紋の 紋様中の座標位置を中心として第2の探索領域が定めら れ、この第2の探索領域が細線化されて第2の特徴点が 抽出され、この抽出された第2の特徴点と第1の特徴点 とが基準ペアとされ、この基準ペアに基づいて照合指紋 の座標上での位置補正が行われるものとなり、XY方向 の最長隆線幅分布波形などに基づいて大まかな位置補正 を行った後に上記位置補正を施すものとすれば、照合指 紋の座標上での位置補正を高精度で行うことが可能とな り、第1発明の効果に加えて、照合精度を髙めることが できるようになるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】照合判定処理においてプライオリティの高い特 徴点から順次ウィンドウを開いて特徴点を抽出して行く 状況を説明する図である。

【図2】本発明の一実施例を示す指紋照合装置のブロッ

【図3】との指紋照合装置における登録プログラムの流 れを示すフローチャートである。

[図4]処理領域に対するノイズ処理を説明するための 3×3画素を示す図である。

【図5】ノイズ処理の後に2値化された処理領域における1ブロックを示す図である。

【図6】画像データからのXY方向の最長隆線幅分布波 形の抽出方法を説明するための図である。

【図7】画像データからのXY方向の最長隆線幅分布波 形の抽出方法を説明するためのフローチャートである。

【図8】画像データから抽出された最長隆線幅分布波形 を示す図である。

【図9】最長隆線幅分布波形からの最長隆線幅極大値抽 出波形の抽出方法を説明するための図である。

【図10】最長隆線幅分布波形から抽出された最長隆線 幅極大値抽出波形を示す図である。

【図11】細線化した後の処理領域の2値化画像の一部 を示す図である。

【図12】細線化された処理領域の2値化画像からの特 徴点の抽出方法を説明するための3×3画素を示す図で 20 ある。

【図13】特徴点(端点および分岐点)からの方向情報 の抽出方法を説明する図である。

【図14】特徴点を中心として段階的に定められた周囲 領域Sの大きさとランクとの関係および中心点からの距 離とディスタンスとの関係を示す図である。

【図15】照合プログラムの流れを示すフローチャート である

【図 1 6 】 照合プログラムにける照合判定処理を示すフローチャートである。

*【図17】特徴点を中心として段階的に定められた周囲 領域Sを示す図である。

14

【図18】第1ウィンドウWD1のX(Y)方向の大き さWD-X(WD-Y)とX(Y)方向の大まかな位置 補正の計算値Av-m1(Av-m2)との関係を示す 図である。

【図19】処理領域における照合指紋の紋様中に開かれたウィンドウWD1~WD13を例示する図である。

【図20】最長隆線幅極大値抽出波形を生成するための 10 フローチャート(極小値の決定フロー)を示す図であ る。

【図21】最長隆線幅極大値抽出波形を生成するためのフローチャート(極大値の決定フロー)を示す図である。

【符号の説明】

1 操作部

1-1 テンキー

1-2 ディスプレイ

1-3 指紋センサ

0 2 コントロール部

2-1 制御部

2-2 ROM

2-3 RAM

2-4 ハードディスク

2-5 フレームメモリ

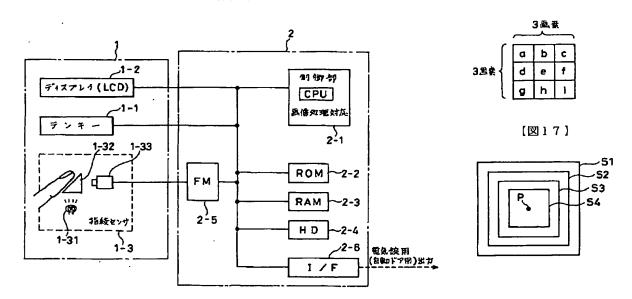
2-6 外部接続部

S(S1~S4) 周囲領域

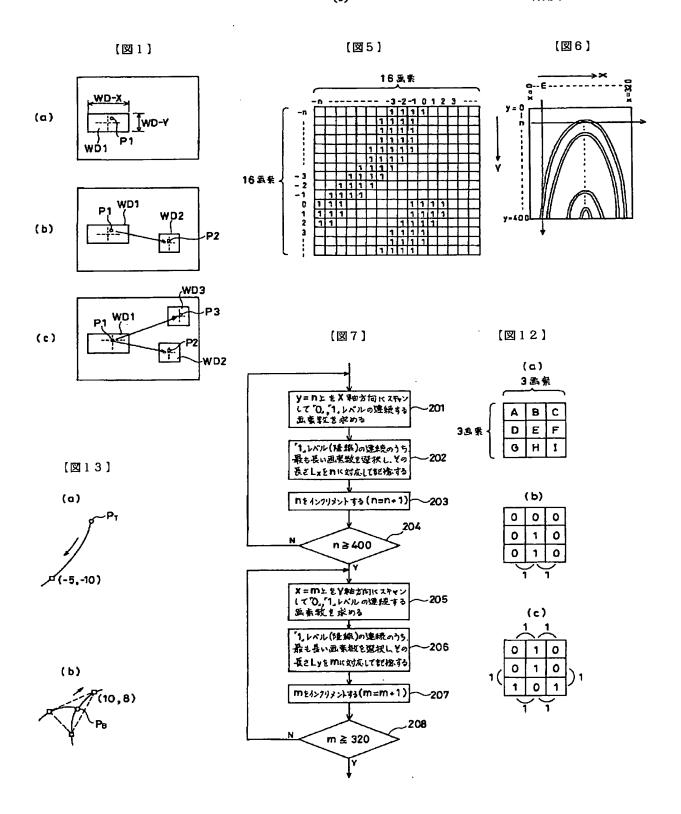
P(P1, P2, P3, P, , P) 特徵点

WD (WD1~WD13) ウィンドウ

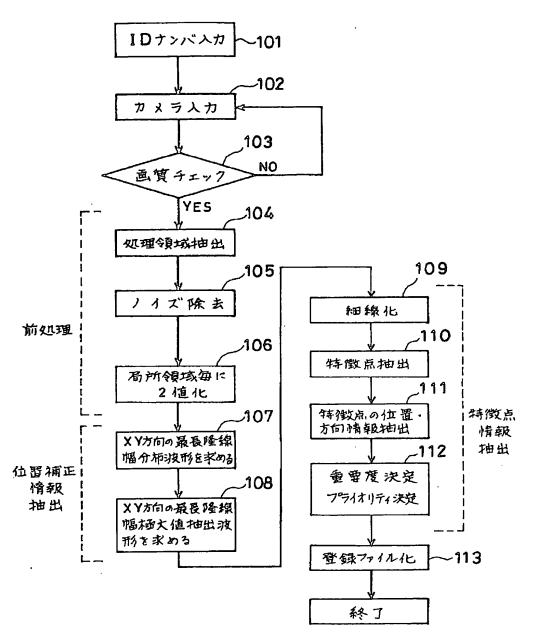
[図2]

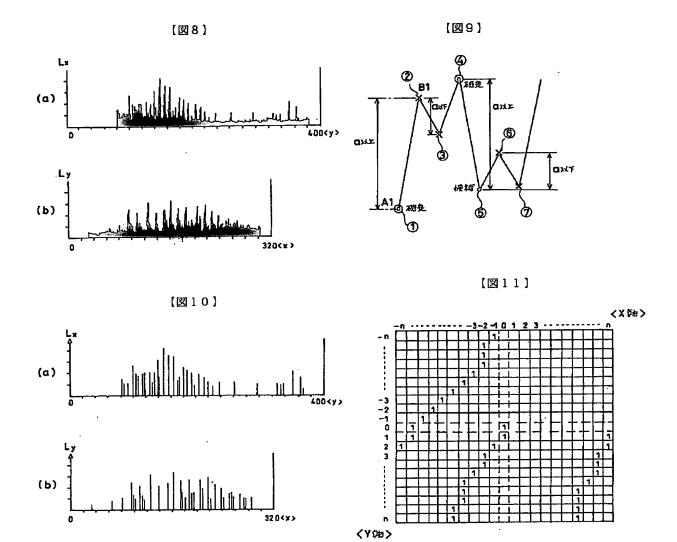


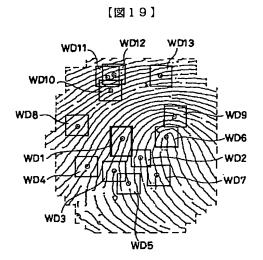
***30**











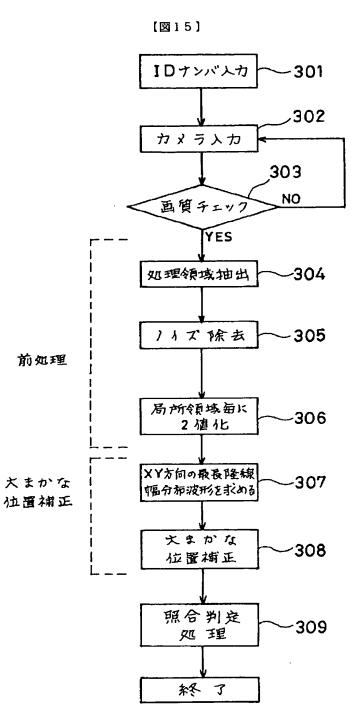
【図14】

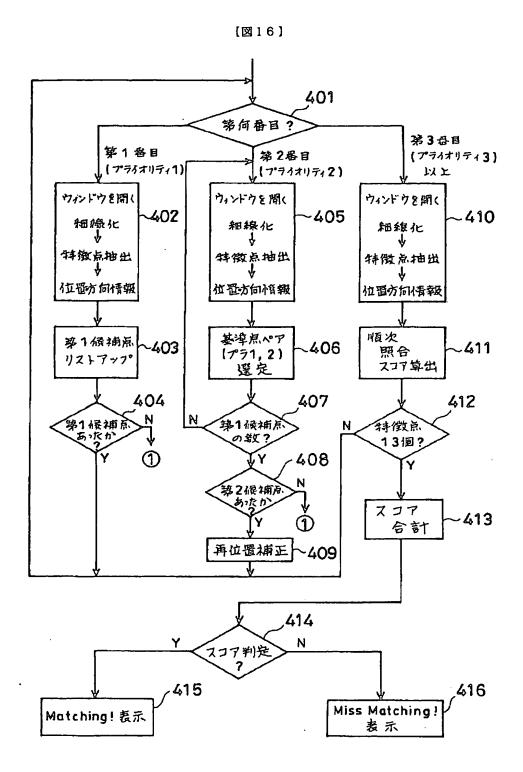
(a)

ランク	周囲領域SのXtt
1	40×40 選集
2	30 × 30 禹集
3	24 × 24 母素
4	10×10 岛东

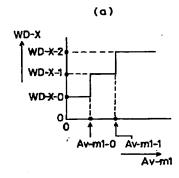
(b)

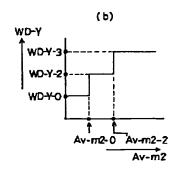
ディス タンス	中心点がらの距離
0	多. 20 ~ 3
1	10~19 與条
	•
10	100~109 重紫



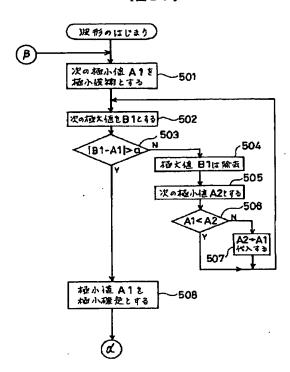


【図18】





[図20]



【図21】

